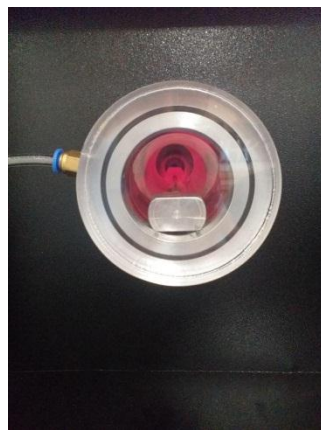


# Nano Pajouhan Raga Co.

## Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD)

رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما DC (جهت سنتز نانولوله های کربنی)

دستگاه لایه نشانی شیمیایی بخار تحت خلا یکی از رایجترین دستگاهها جهت سنتز مواد مختلف می باشد. این دستگاه جهت سنتز نانولوله های کربنی کالیبره شده است اما به دلیل ساختار خود قابلیت سنتز سایر مواد را نیز دارا می باشد.



- ✓ قابلیت رشد نانولوله های کربنی جهتدار و اسپاگتی
- ✓ دارای کوره تیوبی با حداکثر دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد
- ✓ دارای پمپ روتاری با قابلیت خلا تا ۱۰ میلی بار
- ✓ دارای محفظه کوارتز با قطر دهانه ۶۰ میلیمتر
- ✓ دارای فشار سنج پیرانی و نمایشگر
- ✓ دارای دو روتامتر جهت کنترل شار گازهای ورودی
- ✓ قابلیت کنترل مسیر ورود و خروج گازها توسط شیر برقی
- ✓ قابلیت تعویض لوله کوارتز جهت انجام سنتزهای مختلف
- ✓ دارای منبع ولتاژ مستقیم تا ۸۰۰ ولت
- ✓ نمایشگر ولتاژ و جریان

